

ナノインプリント技術のホログラムへの応用

東京理科大学 / 谷口 淳・宮本 岩男

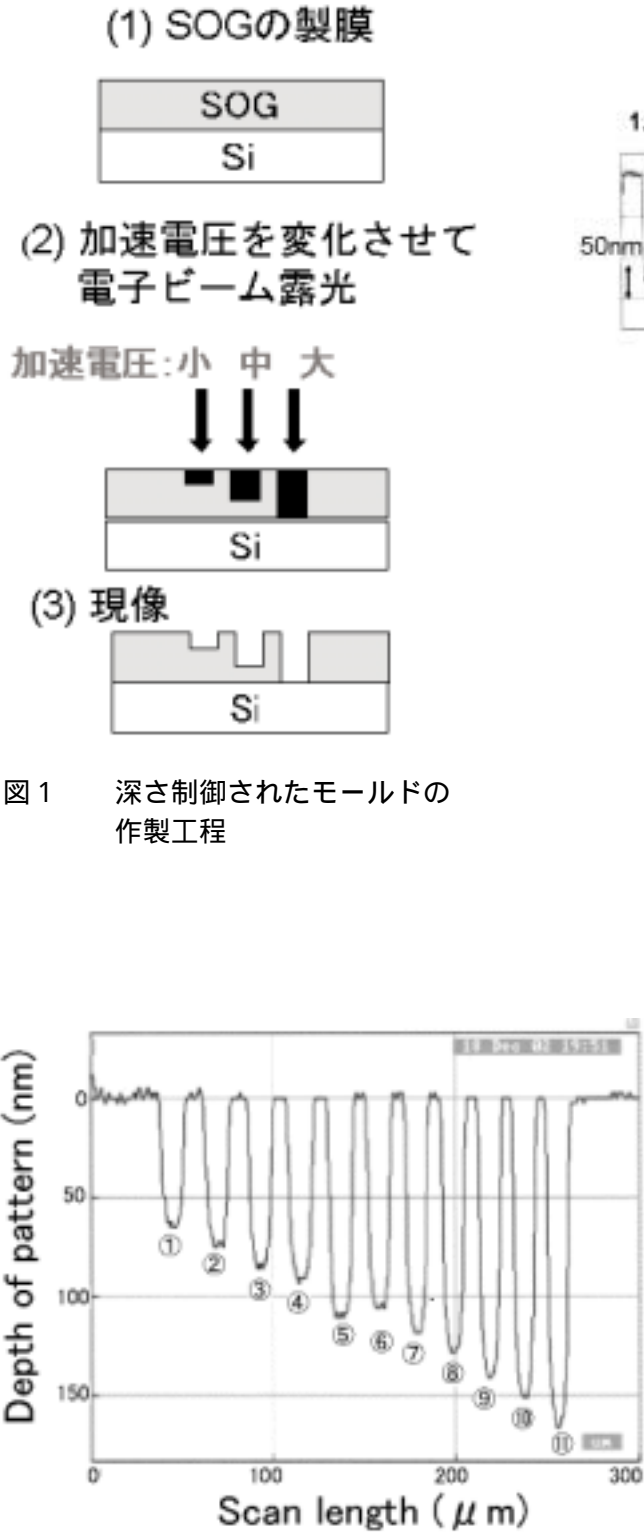


図1 深さ制御されたモールドの作製工程

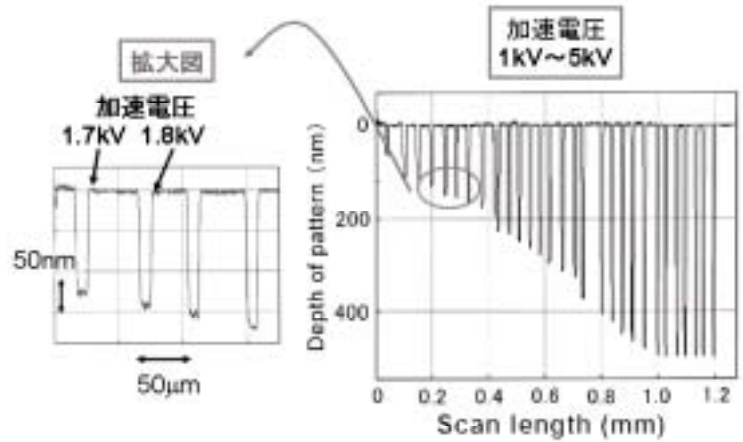


図2. 深さ制御されたモールドの例

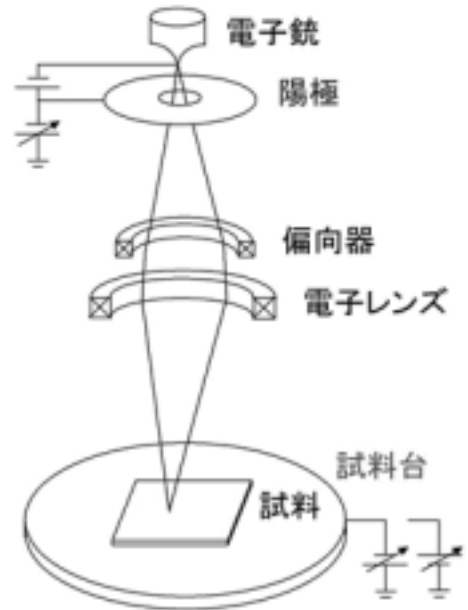


図3 試料台に電圧を加えて加速電圧を変化させる方法

図4 試料台に電圧を加える方法により作製されたパターン

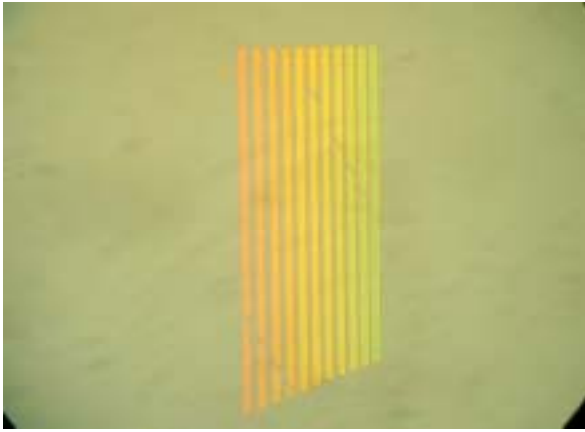


図5 深さ諧調 10nm の場合の
光学顕微鏡写真

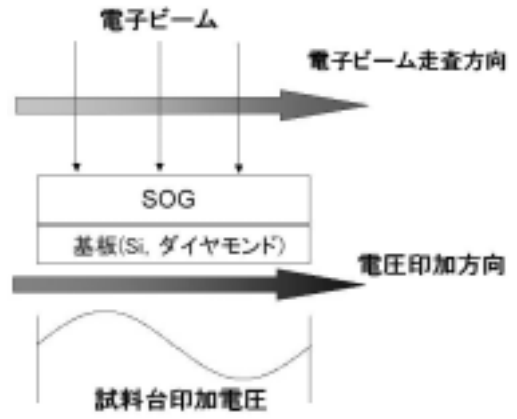


図6 曲面露光法

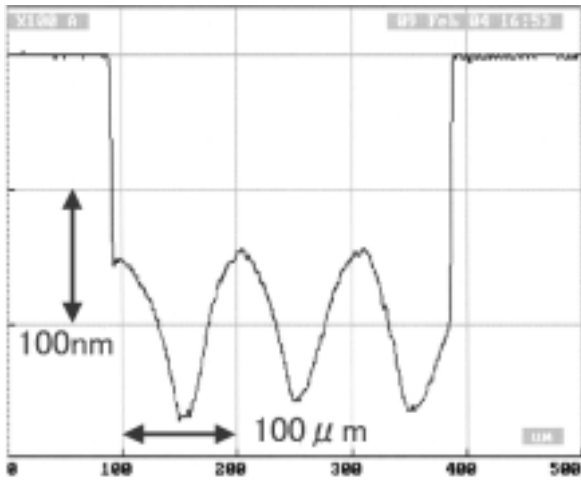
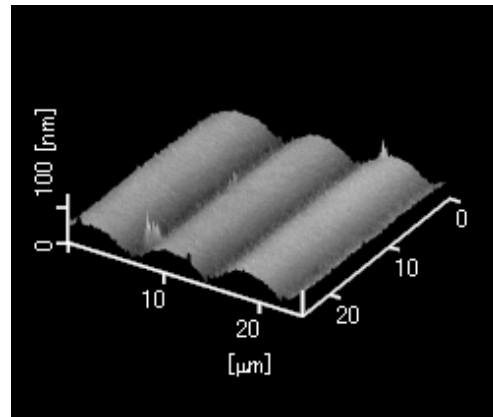
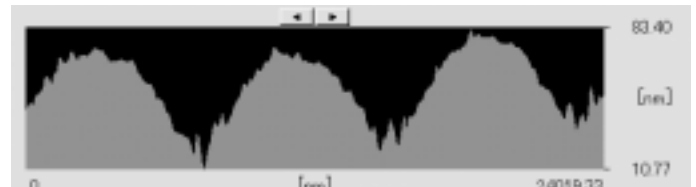


図7 1kV の sin 波を印加しながら
描画したパターン



(a) 3D 像 (AFM)



(b) 断面図

図8 200V の sin 波を印加しながら描画した
パターン